



Рис. 2. Спектры КРС пленок TiO_2 на монокристаллическом кремнии после отжига при температуре 550 °С (образцы 1–3) и 850 °С (образцы 4–6)

Fig. 2. Raman spectra of TiO_2 films on monocrystalline silicon after annealing at temperature of 550 °C (samples 1–3) and 850 °C (samples 4–6)